



中华人民共和国公共安全行业标准

GA/T 1651—2019

法庭科学 真空镀膜显现手印技术规范

Forensic sciences—Technical specifications for fingerprint development
by vacuum deposition system

2019-10-14 发布

2019-12-01 实施

中华人民共和国公安部 发布

中华人民共和国公共安全
行业标准
法庭科学 真空镀膜显现手印技术规范
GA/T 1651—2019

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.spc.org.cn

服务热线: 400-168-0010

2020年5月第一版

*

书号: 155066·2-35136

版权专有 侵权必究

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由全国刑事技术标准化技术委员会指纹检验分技术委员会(SAC/TC 179/SC 3)提出并归口。

本标准起草单位:上海市公安局物证鉴定中心、公安部物证鉴定中心。

本标准主要起草人:张伟方、孙胜军、刘寰、梁彦林、曲会英、李孝君、薛静。

法庭科学 真空镀膜显现手印技术规范

1 范围

本标准规定了真空镀膜显现手印技术的原理、设备、镀膜材料及实验室环境要求、显现准备、操作步骤及注意事项等。

本标准适用于显现大多数非渗透性及部分半渗透、渗透性客体表面潜在手印,包括部分“502”胶熏显后的客体等。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GA/T 144 法庭科学 指纹专业名词术语

3 术语和定义

GA/T 144 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

镀膜真空度 degree of deposition vacuum

镀膜显现手印时,显现容器内所需达到的真空度。

3.2

镀膜 deposition

在客体表面镀上介质薄膜的工艺。

3.3

蒸发源 melting pot

将镀膜材料蒸发成气体的高温加热装置。

3.4

显现角度 development angle

所显客体手印遗留面与水平方向的夹角。

3.5

显现距离 development distance

所显客体手印遗留部位与蒸发源的距离。

3.6

蒸发时间 melting time

镀膜材料受热挥发的时间。

3.7

蒸发电流 melting electric current

蒸发源加热时的电流。